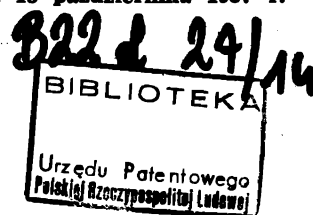


Opublikowano dnia 15 października 1957 r.



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 40087

316² 27/14

KL. 31 c, 12/01

Politechnika Wrocławska Zakład Odlewnictwa*)

Wrocław, Polska

Osłona naboju gazotwórczego do odlewania pod ciśnieniem

Patent trwa od dnia 7 grudnia 1956 r.

Wynalazek dotyczy osłony przeznaczonej do pakietowania naboju gazotwórczego, którą umieszcza się wraz z nabojem we wnęce formy do odlewania ciśnieniowego. Jest ona wykonana z masy, zawierającej jako spoiwo żywicę syntetyczną. Do wyrobu osłony zastosowano mieszankę o następującym składzie chemicznym:

piasek kwarcowy płukany	96,6%,
żywica fenolowo-formaldehadowa	3,0%,
urotropina	0,3%,
nafta	0,1%.

Technologia produkcji osłony jest podobna do technologii wyrobu form lub rdzeni skorupo-

wych. Osłona wykonana z masy żywicznej wyróżnia się dużą wytrzymałością mechaniczną i przepuszczalnością dla gazów, złym przewodnictwem cieplnym, oraz łatwością i szybkością produkcji. Nadaje się ona do zastosowania przy odlewaniu różnych metali oraz może być łatwo magazynowana i transportowana.

Zastrzeżenie patentowe

Osłona naboju gazotwórczego do odlewania pod ciśnieniem, znamienna tym, że jest wykonana z masy, składającej się z 96,6% płukanego piasku kwarcowego, 3% żywicy fenolowo-formaldehadowej, 0,3% urotropiny i 0,1% nafty.

Politechnika Wrocławska
Zakład Odlewnictwa

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest inż. mgr Zdzisław Samsonowicz.